

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成19年7月12日(2007.7.12)

【公表番号】特表2005-534545(P2005-534545A)

【公表日】平成17年11月17日(2005.11.17)

【年通号数】公開・登録公報2005-045

【出願番号】特願2004-526895(P2004-526895)

【国際特許分類】

B 2 8 D	5/04	(2006.01)
B 2 3 K	26/12	(2006.01)
B 2 3 K	26/38	(2006.01)
B 2 3 K	26/40	(2006.01)
H 0 1 L	21/301	(2006.01)

【F I】

B 2 8 D	5/04	A
B 2 3 K	26/12	
B 2 3 K	26/38	
B 2 3 K	26/40	
H 0 1 L	21/78	B

【手続補正書】

【提出日】平成19年5月23日(2007.5.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ケイ素体(W)を紫外線波長または緑色可視光波長レーザー光線(6)で機械加工する方法であって、

前記機械加工する方法は、ビア構造およびダイス列の少なくとも1つの機械加工を含み

a. 前記ケイ素体の少なくとも機械加工位置を液体ハロゲン化物環境またはハロカーボンを含む液体の環境にする工程、

b. 前記液体ハロゲン化物環境またはハロカーボンを含む液体の環境下にある前記ケイ素体の前記機械加工位置にレーザー光線を指向させる工程、

c. 前記ケイ素体と前記液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体との化学反応を前記機械加工位置において十分に起こさせるために、該ケイ素体の機械加工位置近傍において、該液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体をレーザー光線で局所的に加熱する工程、および

d. 前記液体ハロゲン化物環境またはハロカーボンを含む液体の環境から、前記化学反応の副生成物のガスを排出させ、前記化学反応の副生成物の固体粒子は前記液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体に分散させる工程

からなることを特徴とする方法。

【請求項2】

液体ハロゲン化物環境またはハロカーボンを含む液体の環境にする前記工程は、テトラフルオロエタン環境にすることを含む請求項1に記載の方法。

【請求項3】

液体ハロゲン化物環境またはハロカーボンを含む液体の環境にする前記工程は、液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体を収容するための環境チャンバ(2)下におくことからなる請求項1または2に記載の方法。

【請求項4】

液体ハロゲン化物環境またはハロカーボンを含む液体の環境にする前記工程は、冷却液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体の冷却物を供給することを含む請求項1または3に記載の方法。

【請求項5】

冷却液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体の冷却物を供給する前記工程は、該冷却液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体の冷却物の温度を機械加工前、機械加工中および機械加工後において制御することからなる請求項4に記載の方法。

【請求項6】

液体ハロゲン化物環境またはハロカーボンを含む液体の環境にする前記工程は、該液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体を少なくとも前記機械加工位置に送るためのエアゾールノズル手段を準備することを含む請求項1～5のいずれかに記載の方法。

【請求項7】

液体ハロゲン化物環境またはハロカーボンを含む液体の環境にする前記工程は、フッ素、塩素、臭素およびヨウ素の群から選ばれるハロゲンを含有するハロカーボンを供給することを含む請求項1～6のいずれかに記載の方法。

【請求項8】

ケイ素体を機械加工する前記工程は、ケイ素体の熱負荷を制御することによってケイ素体への熱的損傷を実質的に防止する為に、該ケイ素体の温度を制御することを含む請求項1～7のいずれかに記載の方法。

【請求項9】

ケイ素体を機械加工する前記工程は、ケイ素を有効割合で含有する物体を機械加工する工程を含む請求項1～8のいずれかに記載の方法。

【請求項10】

ケイ素を有効割合で含有する物体を機械加工する前記工程は、多層構造体を機械加工する工程を含む請求項9に記載の方法。

【請求項11】

多層構造体を機械加工する工程は、半導体、金属、層間誘電体、セラミック材料を有する多層構造体を機械加工することを含む請求項10に記載の方法。

【請求項12】

紫外線波長または緑色可視光波長レーザーと、少なくともケイ素体の機械加工位置を液体ハロゲン化物環境またはハロカーボンを含む液体の環境にする手段と、

前記液体ハロゲン化物環境またはハロカーボンを含む液体の環境にある前記ケイ素体の前記機械加工位置にレーザー光線を指向させる手段と、

前記ケイ素体と前記液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体との化学反応を機械加工位置において十分に起こさせるために、該ケイ素体の機械加工位置近傍において、該液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体をレーザー光線で局所的に加熱する手段と、

該ケイ素体を機械加工位置においてレーザー光線で機械加工することにより、液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体に、副生成物のガスおよび固形粒子が分散させる手段と、

液体ハロゲン化物環境またはハロカーボンを含む液体の環境からの副生成物のガスを排出させるための排出口、

とからなるケイ素体におけるビア構造およびダイス列の少なくとも1つを機械加工するレーザー機械加工装置(1)。

【請求項13】

前記液体ハロゲン化物環境またはハロカーボンを含む液体の環境にする手段は、液体ハロカーボン環境にするようにアレンジされることを含む請求項12に記載のレーザー機械加工装置。

【請求項14】

前記液体ハロゲン化物環境またはハロカーボンを含む液体の環境にする手段は、テトラフルオロエタン環境にする手段を含む、請求項12に記載のレーザー機械加工装置。

【請求項15】

前記液体ハロゲン化物環境またはハロカーボンを含む液体の環境にする手段は、液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体を収容する環境チャンバを含む請求項12から14までに記載のレーザー機械加工装置。

【請求項16】

前記環境チャンバは冷却液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体の冷却物の浴手段からなる請求項15に記載のレーザー機械加工装置。

【請求項17】

前記環境チャンバは前記液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体の流入口(3)並びに流出口(4)、および気体排出口(5)を備える請求項15または16に記載のレーザー機械加工装置。

【請求項18】

前記環境チャンバは前記レーザー光線(6)を該環境チャンバに導入するための、該レーザー光線を透過する窓(15)を備える請求項15から17のいずれかに記載のレーザー機械加工装置。

【請求項19】

前記窓は反射防止被覆されている請求項18に記載のレーザー機械加工装置。

【請求項20】

冷却液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体の冷却物を前記環境チャンバに供給するための冷却手段を備える請求項12から19に記載のレーザー機械加工装置。

【請求項21】

前記冷却手段は、前記液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体の温度を機械加工前、機械加工中および機械加工後において制御するようアレンジされている請求項20に記載のレーザー機械加工装置。

【請求項22】

前記液体ハロゲン化物環境またはハロカーボンを含む液体の環境にする手段は、該液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体を、少なくとも機械加工位置に送るためのエアゾールノズル手段を備える請求項12から21のいずれかに記載のレーザー機械加工装置。

【請求項23】

前記機械加工位置で機械加工される前記ケイ素体(W)の温度を制御するための温度制御手段を備え、該ケイ素体の熱負荷を制御することによって前記ケイ素体への熱的損傷を実質的に防止するようアレンジされた手段を備える請求項12から22のいずれかに記載のレーザー機械加工装置。

【請求項24】

レーザー光線を指向させるためのテレセントリックレンズ手段をさらに備え、前記テレセントリックレンズ手段の視野を前記冷却液体ハロゲン化物またはハロカーボンを含む液体の冷却物の流れが実質的に満たす請求項20に記載のレーザー機械加工装置。